

高度研所属学生の津田圭輔君 国際会議 Photomask Japan 2019 にて 「Best Academic Poster Presentation 賞」を受賞

兵庫県立大学高度産業科学技術研究所の所属学生の津田圭輔君が 2019/4/16-4/18 に開催された国際会議 Photomask Japan 2019 にて「Best Academic Poster Presentation 賞」を受賞しました。

Photomask Japan は半導体基板のフォトマスク開発に携わる企業、要素技術の開発を進める国研、大学、企業の研究者や技術者が一同に集まり、成果を発表する国内最大のマスク原版に関する国際会議です。

津田君は放射光施設ニューズバルで EUV から深紫外線領域の分光器と反射率計の開発を進めています。特に、実際の多層膜ミラーの反射率を測定し、真空紫外領域にて計算値との乖離が大きいことを実証したことが評価され受賞に至りました。この賞を励みに、EUV リソグラフィーの実用化につながる研究を続けたいとコメントしています。

